

図7-1 ガラスモールドダイオードの組み立て工程

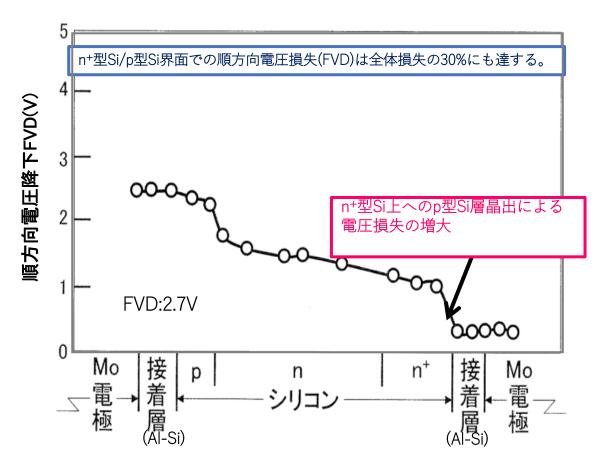


図 7-2 ガラスモールドダイオードにおける電圧分布



図7-9 エッチング後のSiの表面形態 (溝幅10μm、深さ数μm程度)

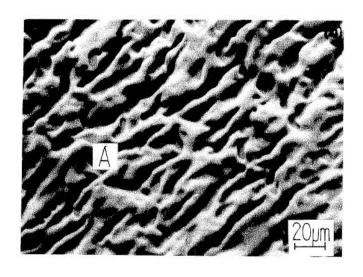


図7-10 n⁺Si上に形成された幅50μm程度の凸部とその周囲の幅10μm程度の溝

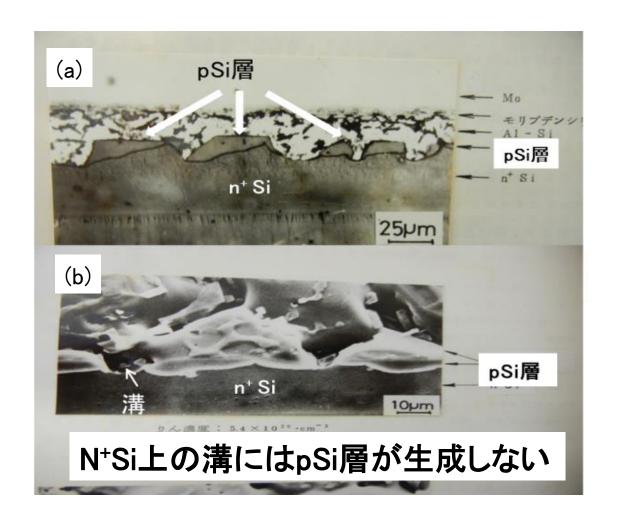


図7-11 再成長層の断面および表面組織

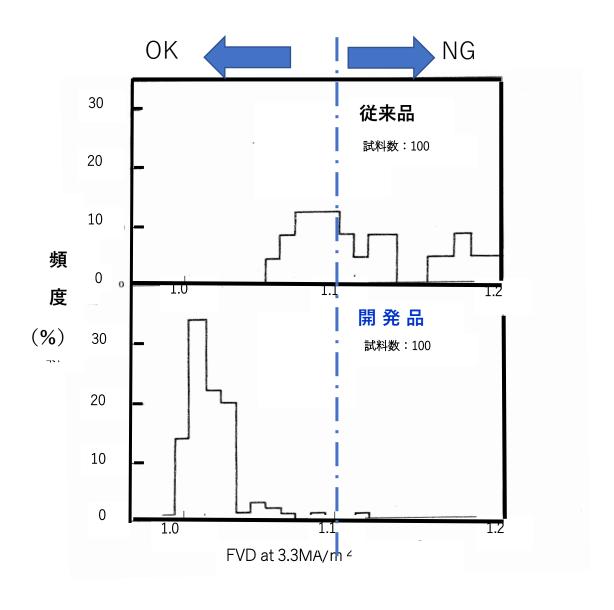


図7-12 ガラスモールドダイオードのFVD分布

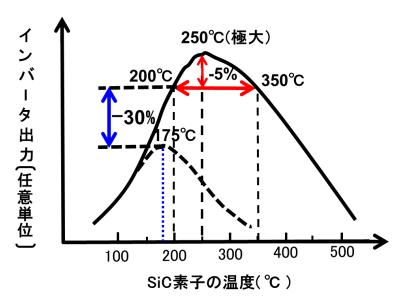


図7-13 インバータ出力に及ぼすSiC素子の温度の影響

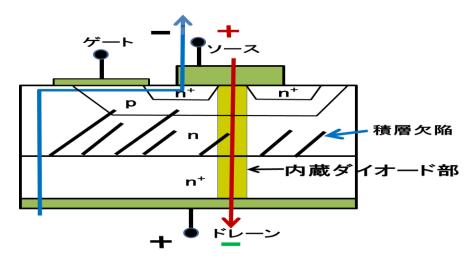


図7-15 SiC-MOSFETの断面構造模式図

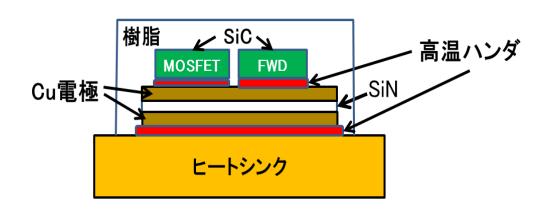


図7-14 SiC半導体モジュールの構造模式図

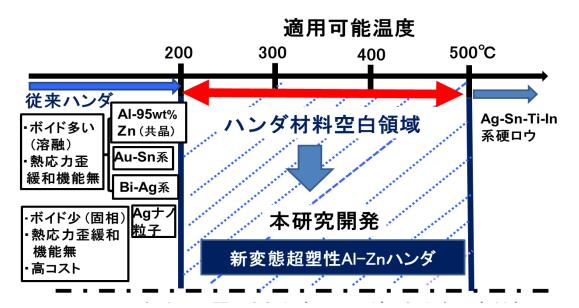


図7-16 従来ハンダの適用温度範囲

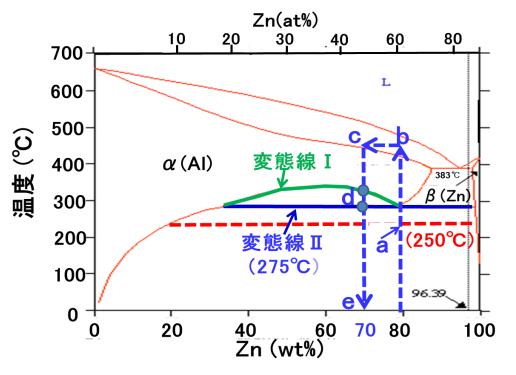
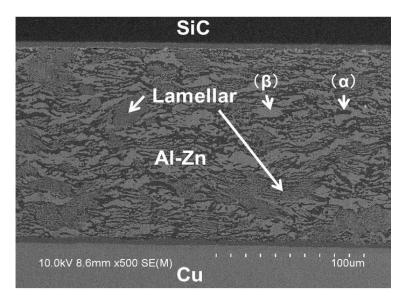


図7-17 Al-Zn2元合金状態図

AI-Zn状態図上で、 $a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow d \Rightarrow e$ の過程をたどって接合

- ① Al-78wt%Znの250℃で発現する超塑性現象を利用して接合界面の清浄化を行う。 (a)
- ② 420°Cに加熱してZnを溶融させ、加圧によりZnのはんだからの排出を促進し、AlをC(70wt%)の組成まで高濃度化する。 (a \rightarrow b \rightarrow c)
- ③ 冷却時の変態超塑性($I \times II$)を利用して 420° Cから 250° Cまでの熱応力を超塑性変形で解消、室温での熱応力を緩和する。 $(c \rightarrow d \rightarrow e)$



接合条件: 250°Cx10分+ 420°Cx10分、 加圧力15MPa

図7-18 SiC/AI-Znハンダ接合部の断面微細組織

表7-1 各種金属の減衰能

材料	減衰能(Q-1)
Pb	10-2
Al-70wt%Zn (ラメラ構造)	10 ⁻³
AI-95wt%Zn (共晶)	3x10 ⁻⁴
Al. Cu, Ag	10 ⁻⁴

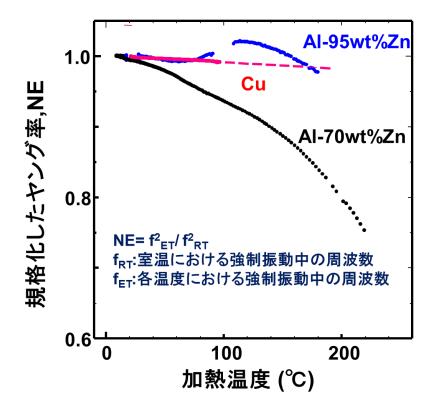
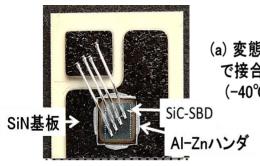


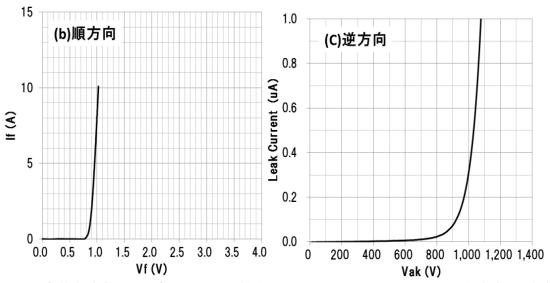
図7-19 減衰能の温度依存性



(a) 変態超塑性Al-Zn高温はんだ で接合したSiC Schottky diode(SBD)信頼性試験 (-40℃~300℃、5000サイクル)後の外観写真

図 7-20 Al-Znはんだで接合したSiC-SBDの外観

(b) 信頼性試験後のデバイス特性



-40℃~300℃ 温度サイクル試験 5000サイクル後も剥離などは起きず、 良好なデバイス特性を維持している。

図6 変態超塑性Al-Zn高温はんだで接合したSiC Schottky diode(SBD)の信頼性試験後 (-40°C~300°C、5000サイクル)の電流−電圧特性

図7-21 変態彫塑性AI-Zn高温ハンダで接合したSiC-SBDの信頼試験後 (-40°C~300°C、5000サイクル)の電流ー電圧特性